

令和7年度大谷美術館賞 募集要項

1. 目的

材料表面の美的評価向上に関する優れた作品及び顕著な技術・業績に対し大谷美術館賞を授与し、その経緯・努力を顕彰することを目的とする。

2. 対象者

上記の業績・作品を挙げた個人または団体

3. 応募要項

公益財団法人大谷美術館が委嘱した推薦者による推薦、または個人もしくは法人による応募

提出物：応募票(フォーマットに準じてA4 4枚まで)

及び添付説明書・参考資料等 各1部

(郵送及びPDFにてお送り願います。)

提出先・問合せ先：公益財団法人大谷美術館（担当益田）

〒114-0024

東京都北区西ヶ原1-27-39 旧古河庭園内

公益財団法人大谷美術館

TEL：03-3910-8440 FAX：03-3910-8505

E-mail:masuda@otanimuseum.or.jp

応募締め切り：令和7年9月30日（火）

4. 審査

公益財団法人大谷美術館が委嘱した審査委員による審査委員会で審査・選考

5. 審査の過程

一次審査： 応募票及び添付説明書・参考資料等による書類審査

二次審査： 授賞候補者による発表会後の審査

三次審査： 必要に応じて実地調査を行い、選考結果を審査委員会より
公益財団法人大谷美術館に報告

なお、二次審査については12月初旬を予定、一次審査確定後、別途ご連絡します。

6. 授賞者の決定

大谷美術館審査委員会の議に基づき授賞者を決定

(留意事項)

入選作品については、公益財団法人大谷美術館が以下の利用を無償で行うことを、予めご承諾お願いいたします。

- ・入選作品集やHP上への掲載等を含む選考結果の公表
- ・公益財団法人大谷美術館、その他適切な場所における入選作品（原作品もしくは画像その他のデータ）の展示
- ・公益財団法人大谷美術館の資料等での紹介（但し、権利者・出所を明記）

応募作品については、大谷美術館賞応募作品として、当館資料に記録・保存（大谷美術館賞選考過程における検討資料としての使用を含む）させていただきます。また、個別に応募者のご承諾を得て、応募作品を当社HP、資料等でご紹介することがあります。

応募作品は、第三者の著作権その他の権利（及びこれらに準ずるもの）に抵触、侵害するものではないことをご確認お願いいたします。

大谷美術館賞応募票

令和 年 月 日

応募者/推薦者 氏名
住所

印

電話:

FAX :

e-mail:

下記の通り、大谷美術館賞候補者を応募/推薦します。

業 績 作品題目			
候 補 者 事 業 体	氏名	住所・勤務先	連絡先電話
応募/推薦 理由			
候 補 者	勤務先	住所	
	部 署		
	氏 名	電話	Email
調 査 先	名称	電話	
	住所	交通機関	

業績・作品の概要	<p>(1)概要と目標</p> <p>(2)完成までの経緯 (製品が完成するまでの背景や工夫等)</p> <p>(3)内容と特徴 (独創性、機能性、デザイン性、克服した課題、他への貢献度、将来性等)</p> <p>(4)成 果(販売実績等)</p>
業績の公表等	<p>(論文、特許、他の受賞歴等)</p>
備考	<p>(特筆すべき事項等)</p>